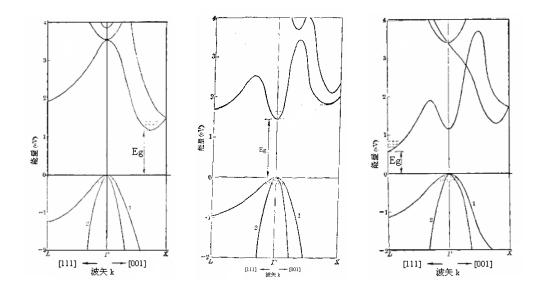
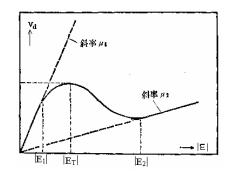
姓名

东南大学考试卷(卷)

	课程名称	半导体物理	考试的	考试学期		得分	
 		电子科学				120 分钟	
1	一、 填空 (4	再空1分,共 27 分	})				
	1. 纯净半导体 Si 中掺Ⅲ族元素的杂质, 当杂质电离时从 Si 中夺取, 在 Si 晶体						
	的共价键中产生了一个,这种杂质称杂质;相应的半导体称						
	型半导体。						
深		□载流子浓度存在注 子将做; 。					
	3. np>n _i ²意味	着半导体处于		其中 n=		_;	
i i i i i i i i i i	p。这时半导体中载流子存在净复合还是净产生?。						
		能级杂质的主要的			; 深能级	杂质所起的	
	5. 非平衡载流 与 寿命 τ 趋向最	泛子通过	而消失, 在			τ, 寿命 τ 切相关, 当	
1 1	6. 半导体中的	小。				下起主	
1977		在					
		\$杂浓度很高时, (增大、减		(增大	、减小、不变?)	,禁带宽度	
, !	8. p-n 结电容 容起主要作用	F包括F	电容和	电容,在	E反向偏压下,	电	
	二、 简要回答(共40分)						
į	1. 什么是直接复合? 什么是间接复合? 试述它们在半导体器件中的作用。						
 	2 何谓非简	2 何谓非简并化半导体? 何谓简并化半导体?					
 	3. 下图分别	月是半导体材料 Si	、Ge、GaAs 的能	带结构示意	图。		



- (1) 请指出图 a 、图 b、 图 c 分别对应何种材料, 您判断的依据是什么?
- (2) 在三幅图中,价带对于同一个 K, E(K) 可以有两个值,表明对应两种有效质量不同的空穴,即重空穴和轻空穴。试指出曲线 1、2 分别对应哪种空穴,依据是什么?
- 4. 当 GaAs 样品两端加电压时,样品内部便产生电场 E。电子的平均漂移速度 v_d 随电场的变化关系如下图所示,请解释之。



5. 若在掺有受主杂质 N_a 的 p 型衬底上采用扩散工艺又掺入一层浓度为 N_b 施主杂质,且 N_b >> N_a ,本征载流子浓度为 n_i 。(1)写出接触电势差 V_b 的表达式;(2)画出平衡时 p-n 结的能带图,请问 p 区和 n 区哪边的势垒宽度宽?(3)说明外加正向偏置时,正向扩散电流的主要成分是电子电流还是空穴电流?(4)若外加正向电压为 V_f 时,分别写出注入 p 区和 n 区的载流子浓度?

三、 计算(共33分)

1. (8 分)早期锗硅等半导体材料常利用测其电阻率的办法来估计纯度,若测得室温下电阻率为 $10\,\Omega\cdot cm$,试估计 N 型锗的纯度,并讨论其局限性。(300K 较纯锗样品的电子迁移

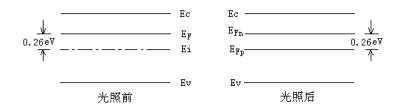
第 2 页

共 3 页

率 $\mu_n = 3900 cm^2 V^{-1} s^{-1}$,锗原子密度 d=4.42×10 22 cm $^{-3}$,电量 e=1.6×10 $^{-19}$ A.s)。

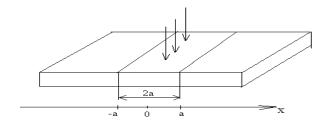
2.(9 分)一个半导体棒,光照前处于热平衡态,光照后处于稳定态的条件,分别由下图给出的能带图来描述。设室温(300K)时的本征载流子浓度 $n_i=10^{10}$ cm⁻³, 试根据已知的数据确定:

- (1) 热平衡态的电子和空穴浓度 no和 po;
- (2) 稳定态的空穴浓度 p;
- (3) 当棒被光照射时,"小注入"条件成立吗? 试说明理由。



3. (8分)如图所示,一个很长的掺杂均匀的 n 型半导体样品,其中心附近长度为 2a 的范围内被一稳定光照射,假定光均匀的穿透样品,电子-空穴对的产生率为 G。

(少子的连续性方程为
$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x} - \mu_p \left| \bar{E} \right| \frac{\partial P}{\partial X} - \mu_p P \frac{\partial \left| \bar{E} \right|}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + G$$
)



(1) 写出整个样品在小注入条件下的少数载流子方程表达式

(2) 写出边界条件